Four Rotatif Incliné Pour Le Dépôt Chimique Amélioré Par Plasma (Pecvd)

Numéro d'article: KT-PE16

Introduction

Four tubulaire PECVD avancé pour le dépôt précis de couches minces. Chauffage uniforme, source de plasma RF, contrôle des gaz personnalisable. Idéal pour la recherche sur les semi-conducteurs.

En savoir plus

Modèle de four	PE-1600-60
Température maximale	1600℃
Température de travail constante	1550℃
Matériau du tube du four	Tube en Al2O3 de haute pureté
Diamètre du tube du four	60 mm
Longueur de la zone de chauffage	2 x 300 mm
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine japonaise
Élément chauffant	Disiliciure de molybdène
Vitesse de chauffage	0-10℃/min
Couple thermique	Type B
Contrôleur de température	Régulateur PID numérique/écran tactile
Précision du contrôle de la température	±1℃
Unité plasma RF	
Puissance de sortie	5 -500W réglable avec une stabilité de ± 1%
Fréquence RF	13,56 MHz ±0,005% de stabilité
Puissance de réflexion	350W max.
Adaptation	Automatique
Bruit	<50 dB
Refroidissement	Refroidissement par air.
Unité de contrôle précise du gaz	
Débitmètre	Débitmètre massique MFC
Canaux de gaz	4 canaux
Débit	MFC1 : 0-5SCCM O2 MFC2 : 0-20SCMCH4 MFC3 : 0- 100SCCM H2 MFC4 : 0-500 SCCM N2
Linéarité	±0,5 % DE L'E.M.

Répétabilité	±0,2 % DE L'E.M.
Tuyau et vanne	Acier inoxydable
Pression de fonctionnement maximale	0,45 MPa
Contrôleur de débitmètre	Contrôleur numérique à bouton/écran tactile
Unité de vide standard (en option)	
Pompe à vide	Pompe à vide à palettes
Débit de la pompe	4L/S
Orifice d'aspiration du vide	KF25
Jauge à vide	Jauge à vide Pirani/Résistance en silicone
Pression nominale du vide	10Pa
Unité de vide poussé (en option)	
Pompe à vide	Pompe à palettes+pompe moléculaire
Débit de la pompe	4L/S+110L/S
Port d'aspiration du vide	KF25
Jauge à vide	Jauge à vide composée
Pression nominale du vide	6x10-5Pa
Les spécifications et configurations ci-dessus peuvent être personnalisées.	

Non.	Description	Quantité
1	Fourneau	1
2	Tube de quartz	1
3	Bride à vide	2
4	Bloc thermique du tube	2
5	Crochet du bloc thermique du tube	1
6	Gant résistant à la chaleur	1
7	Source de plasma RF	1
8	Contrôle précis des gaz	1
9	Unité de vide	1
10	Manuel d'utilisation	1